明細書

ガス冷却式真空熱処理炉およびその冷却ガス方向切替え装置

5

発明の背景

発明の技術分野

本発明は、ガス冷却式真空熱処理炉およびその冷却ガス方向切替え装置に関する。

10 関連技術の説明

15

20

25

真空熱処理炉は、内部を減圧した後、不活性ガス等を再充填して被処理品を熱処理する熱処理炉である。真空熱処理炉は、加熱後に炉内及び処理品についた水分等がガス化した後に再度減圧し、不活性ガス等を再充填することで、水分を完全に除去できるため、水分による色付きのない熱処理(「光輝熱処理」と呼ぶ)ができる利点がある。

また、ガス冷却式真空熱処理炉は、光輝熱処理ができ、かつ脱炭浸炭がない、変形が少ない、作業環境が良いなど、種々の利点を有する。しかし、初期のガス冷却式真空熱処理炉は、減圧冷却式であるため、冷却速度が不十分な欠点があった。そこで、冷却速度を高めるために、高速循環ガス冷却方式が実用化されている。

図1は、非特許文献1に開示された高速循環ガス冷却炉の構成図である。この図において、50は断熱材、51はヒータ、52は有効作業域、53は炉体及び水冷ジャケット、54は熱交換器、55はターボファン、56はファン用モータ、57は冷却扉、58は炉床、59はガスディストリビュータ、60は冷却ガスの流れ方向(風路)を切替えるダンパーである。

また、特許文献1の「真空炉におけるガス循環冷却促進法」は、図2に示すように、気密性の真空容器61内に断熱壁67によって囲った加熱室66を設け、加熱室内に配置されたヒータ62により被熱物64を真空中で加熱すると共に、真空容器61内にクーラ62およびファン63が設けられ真空容器内に供給され

た無酸化性ガスをクーラ62により冷却し、無酸化性ガスをファン63の回転により加熱室66の相対する断熱壁67面に設けられた開口68,69より加熱室66内に循環させて被熱物64を強制ガス循環冷却する真空炉において、少なくとも一端が末広がり状に形成れた耐熱性の筒状フード65を加熱室66内に置かれた被熱物64の周囲を適宜間隔を離して囲うように、かつその両端が前記開口68,69に相対するように配置して無酸化性ガスを加熱室66内に循環させるようにしたものである。なお、この図において70は冷却ガスの流れ方向(風路)を切替えるダンパーである。

【非特許文献1】

5

25

10 山崎勝弘,金属材料の真空熱処理(2),熱処理30巻2号,平成2年4月 【特許文献1】

特開平5-230528号公報

非特許文献1及び特許文献1に記載の高速循環ガス冷却がは、加熱と冷却を同一の場所で行うため、以下の問題点があった。

- 15 (1)加熱終了時に加熱用のヒータや炉体が高温になっており、冷却時にヒータ や炉体も同時に冷却するため、熱処理材を高速冷却できない。
 - (2) 熱処理材を囲んで加熱用のヒータや炉体があるため、冷却時に冷却ガスを均一に供給できない。
- (3)上下方向に交互にガス冷却する場合でも、上向きと下向きの両方の冷却ガ 20 スを均一な速度と向きに整流する手段はなく、熱処理材全体の歪みを低減するこ とが困難であった。

また、上述した非特許文献1及び特許文献1に記載の高速循環ガス冷却炉において、上向きと下向きのガス流れ方向(風路)を切り替える機構として上下にダンパー装置が通常用いられている。しかし、上下のダンパー装置を冷却ガス方向切替え機構とした場合、以下の問題点があった。

- (4) ダンパー装置は、その開閉位置により高速で通過する風圧による負荷変動が大きい。そのため、高圧ガスの場合にダンパー方式では風圧の影響でスムースに動かすことが困難である。
 - (5) ダンパー装置は、開閉角度と開口面積が比例しない。そのため、上下の複

数の駆動装置を切り替える際に、開口面積のバランスを整えることが難しく、吸 込口及び吐出口の開口面積に差が生じたり、その変動が大きくなり、 冷却ガス量 が変動し、安定したガス冷却が困難である。

- (6)上下に複数のダンパー装置が存在し、複数の駆動装置が必要であり、構造 が複雑となる。
 - (7) 開口面積が上下にダンパー装置で限定され、炉体内面積に比べて小さい。

発明の要約

- 10 本発明は、上述した問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の第1の目的は、冷却時に熱処理材を高速冷却することができ、熱処理材全体に冷却ガスを均一に供給でき、かつ上向きと下向きの両方において冷却ガスを均一な速度と向きに整流して熱処理材全体の歪みを低減することができるガス冷却式真空熱処理炉を提供することにある。
- 15 また、本発明の第2の目的は、風圧の影響を受けにくくスムースにガス流れ方向(風路)を切替えることができ、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積差が生じにくく、安定したガス冷却が可能であり、構造が簡潔であり単一の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できるガス冷却式真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置を提供することにある。

20

25

第1の目的を達成するために、第1の発明によれば、加熱した被処理品を加圧した循環ガスで冷却するガス冷却炉を備えたガス冷却式真空熱処理炉であって、前記ガス冷却炉は、被処理品を静置する冷却領域を囲みその内側に上下方向に断面一定のガス流路を形成する冷却室と、該冷却室内を上下方向に通過するガスを冷却して循環させるガス冷却循環装置と、冷却室内を上下方向に通過するガスの方向を交互に切り替えるガス方向切替え装置と、冷却室の上端及び下端を塞ぎ通過するガスの速度分布を均一化させる上下の整流器と、を備えたことを特徴とするガス冷却式真空熱処理炉が提供される。

第1の発明によれば、上下の整流器により、冷却室の上端及び下 端を塞ぎ通過

するガスの速度分布を均一化させるので、冷却領域を通過するガス流の速度変化を最少限度に抑えることができ、被処理品に対して乱れの少ない冷却ガスを吹き付けることができる。また、被処理品を通った後の出口 部も均等に冷却ガスを排出することで、被処理品の中央部にも均等に冷却ガスを 通すような強制力が発揮され、熱処理材全体の歪みを低減することができる。

5

10

第2の発明は、第1の発明の好ましい実施形態であり、前記上下の整流器は、 互いに積層された均等分配部と整流部とからなり、或いは均等分配部と整流部の 両機能を備え、均等分配部は、上昇ガス流の圧力損失係数0.1以上の流路抵抗 をつけることにより流速の均等分配化を図るために前記上昇ガス流に直交する方 向に均等に配置された複数の圧損発生手段を有し、整流部は、均等分配部を通過 した上昇ガス流の流れ方向を整流する複数の整流グリッドからなる。

第2の発明によれば、複数の圧損発生手段により流速分布を均等化し、複数の 整流グリッドによりガス流の流れ方向を均等化できる。

第3の発明は、第1の発明の好ましい実施形態であり、冷却室の上下に冷却室 15 から流出入するガス流の方向を案内する補助分配機構を設ける。

第3の発明によれば、補助分配機構(例えば吹き込み板)を設けることにより、 冷却室の上下面積が大きい場合でも、複数箇所に向かうガス流の方向を最適化し、 流れの均一化を高めることができる。

第4の発明は、第1の発明の好ましい実施形態であり、前記ガス冷却循環装置は、冷却室に隣接して設置され冷却室を通過したガスを吸引して加圧する冷却ファンと、該冷却ファンに吸引されるガスを間接冷却する熱交換器とからなり、前記ガス方向切替え装置は、前記熱交換器を間隔を隔てて囲む中空のカウリングと、該カウリングを昇降させる昇降シリンダとを備え、前記カウリングは、下降位置において冷却室の下方と連通する下方吸引口と、上昇位置において冷却室の上方と連通する上方吸引口とを有する。

第4及の発明によれば、ガス方向切替え装置により下方吸引口と上方吸引口を 交互に冷却ファンの吸引側に連通させることにより、冷却室内を上下方向に通過 するガスの方向を交互に切り替えることができる。この切替えにより、整列化さ れた被処理品の位置による冷却速度の差を低減し、熱処理材全体の歪みを低減す ることができる。

5

10

15

20

25

第2の目的を達成するために、第5の発明によれば、被処理品を静置する冷却 領域を囲む冷却室と、該冷却室内を通過するガスを冷却して循環させるガス冷却 循環装置とを備え、加熱した被処理品を加圧した循環ガスで冷却するガス冷却式 真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置であって、冷却室とガス冷却循環装置と の間を仕切る固定仕切板と、該固定仕切板の表面に沿って回転駆動される回転仕 切板とを有し、固定仕切板はほぼ全面を貫通する開口を有し、回転仕切板は、ガ ス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸引開口と吐出開口を有し、 これにより冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替える、ことを特徴とす るガス冷却式真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置が提供される。

第5の発明によれば、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板の表面に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替えるので、流れ方向に対して回転仕切板が垂直に動く回転駆動であるため、高圧ガス(密度が高いガス体)であっても風圧の影響を受けにくくスムースに風路を切替えることができる。

また、回転仕切板が、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する 吸引開口と吐出開口を有するので、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積 差が生じにくく、安定したガス冷却が可能である。また、構造が簡潔であり単一 の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる。

第6の発明は、第5の発明の好ましい実施形態であり、前記冷却室は、その内側を上下方向に通過するガス流路を有し、冷却室内をガスが下方に流れるときに、吸引開口が冷却室の下方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の上方のみと連通し、冷却室内をガスが上方に流れるときに、吸引開口が冷却室の上方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の下方のみと連通するように開口位置が設定されている。

第6の発明によれば、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る炉体内面積Aのうち、1/2づつをガス冷却循環装置の吸込口と吐出口とし、更に吸込口と吐出口のうち、1/2づつを下方、上方とすることで、吸引開口と吐出開口を炉体内面積Aの約1/4づつに設定することができる。従って、従来に比較して風路

面積を大きくとれ、ガスの通過流速を低減でき、圧損を小さくできる。

5

10

20

25

また、固定仕切板とガス冷却循環装置の間は、内側全面がガス冷却循環装置の 吸込口に連通し、外側全面だガス冷却循環装置の吐出口に連通しているので、吐 出口/吸込み口の隙間を十分取ることで半面しか、開口していなくても反対面への 回り込みが可能となり、熱交換器全体を有効利用できる。

第7の発明は、第5の発明の好ましい実施形態であり、前記冷却室内をガスが上下方向に流れるときに、吸引開口が冷却室の下方のみ又は上方のみと選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の上方のみ又は下方のみと選択的に連通し、前記冷却室内をガスが水平方向に流れるときに、吸引開口が冷却室のいずれかの片側のみに選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の反対の片側のみと選択的に連通するように開口位置が設定されている。

第7の発明によれば、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板の 表面に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過するガスの方向 を上下方向及び左右方向に自由に切り替えることができる。

15 第8の発明は、第5の発明の好ましい実施形態であり、前記ガス冷却循環装置は、冷却室に隣接して設置され冷却室を通過したガスを吸引して加圧する冷却ファンと、該冷却ファンから吐出されるガスを間接冷却する熱交換器とからなる。

第8の発明によれば、固定仕切板とガス冷却循環装置の間は、内側全面がガス 冷却循環装置の吸込口に連通し、外側全面だガス冷却循環装置の吐出口に連通し ているので、吐出口/吸込み口の隙間を十分取ることで半面しか開口していなく ても反対面への回り込みが可能となり、熱交換器全体を有効利用できる。

本発明のその他の目的及び有利な特徴は、添付図面を参照した以下の説明から明らかになろう。

図面の簡単な説明

図1は、非特許文献1に開示された高速循環ガス冷却炉の構成図である。 図2は、特許文献1の「真空炉におけるガス循環冷却促進法」の構成図である。 図3は、本発明の実施例によるガス冷却式真空熱処理炉の全体構成図である。 図4は、図3の部分拡大図である。

図5は、図4のA-A線における断面図である。

図6は、本発明の第1実施例による冷却ガス方向切替え装置を備えた真空熱処理炉の全体構成図である。

5 図7は、図6の部分拡大図である。

10

20

25

図8は、図7のB部拡大図である。

図9A、Bは、図7のC-C線における断面図である。

図10A, Bは、本発明の第2実施例による冷却ガス方向切替え装置を示す図5と同様の断面図である。

好ましい実 施例の説明

以下、本発明の好ましい実施例を図面を参照して説明する。なお、各図において、共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。

15 図3は、本発明によるガス冷却式真空熱処理炉の全体構成図である。この図に示すように、本発明の真空熱処理炉は、真空加熱炉10、ガス冷却炉20、及び移動装置30を備える多室型熱処理炉である。

真空加熱炉10は、被処理品1を減圧した後、不活性ガス等を再充填して加熱する機能を有する。ガス冷却炉20は、加熱した被処理品1を加圧した循環ガス2で冷却する機能を有する。移動装置30は、被処理品1を真空加熱炉10とガス冷却炉20との間で移動する機能を有する。なお、本発明は多室型熱処理炉に限定されず、真空加熱とガス冷却を単室で行う単室炉であってもよい。

真空加熱炉10は、内部が真空排気されるようになった真空容器11、被処理品1を内部に収容する加熱室12、加熱室に被処理品1を出し入れするための前扉13、加熱室内の被処理品1を移動させるための開口を閉じる後扉14、被処理品1を前後に水平移動可能に載せる載置台15、被処理品1を加熱するためのヒータ16、等からなる。この構成により、真空容器11の内部を真空に減圧し、ヒータ16により被処理品1を所定の温度まで加熱することができる。

移動装置30は、被処理品1を真空加熱炉10とガス冷却炉20との間で水平

に移動させる搬送棒32、後扉14を昇降させて開閉する後扉昇降装置33、前扉13を昇降させて開閉する前扉昇降装置34、及びガス冷却炉20の中間断熱扉21aを昇降させて開閉する中間扉昇降装置34を備える。この例において、搬送棒32はラックピニオン駆動、後扉昇降装置33は直動シリンダ、前扉昇降装置34と中間扉昇降装置34は巻上げ機であるが、本発明はこれに限定されず、その他の駆動機構であってもよい。この構成により、後扉14、前扉13及び中間断熱扉21aを開放した状態で、搬送棒32により、被処理品1を真空加熱炉10とガス冷却炉20との間で水平に移動させることができる。

5

25

図4は図3の部分拡大図であり、図5は図4のA-A線における断面図である。 10 図3~図5に示すように、ガス冷却炉20は、真空容器21、冷却室22、ガス 冷却循環装置24、ガス方向切替え装置26及び整流器28を備える。

真空容器21は、真空加熱炉10の前扉13に対向して設けられた中間断熱扉21a、被処理品1を内部に収容する円筒形の容器胴部21b、ガス冷却循環装置24を収容する循環部21c、及び気密に開閉可能なクラッチリング21d,21eからなる。この構成により、クラッチリング21eを開放し循環部21cを容器胴部21bから図3で右方に後退させることにより、被処理品1を容器胴部21bの内部に直接収納することができる。また、クラッチリング21d,21eにより中間断熱扉21aと循環部21cを容器胴部21bに気密に連結し、加圧した冷却用ガス(アルゴン、ヘリウム、窒素、水素等)を内部に供給することにより、加圧ガスを冷却に用いることができる。

冷却室22は、真空加熱炉10に隣接して容器胴部21bの中央部に設けられる。冷却室22の真空加熱炉側は中間断熱扉21a、ガス冷却循環装置と両側面は気密性のある断熱壁22a、22bで仕切られている。またこの冷却室22は、上下端は開口しており、かつその内側に上下方向に断面一定のガス流路を形成している。この冷却室22の内側が冷却領域であり、被処理品1は、例えばギヤ・シャフトジェットエンジンの動翼、静翼、ボルト等の小型金属部品であり、トレーやバスケット内に収容し、冷却室22の中央に通気性のある載置台23に載せて静置される。

載置台23は真空加熱炉10の載置台15と同一高さに設置され、内蔵するロ

WO 2005/001360 PCT/JP2004/004643

ーラ上を自由に移動できるようになっている。また、容器胴部21bと断熱壁2 2bの間に、図5に示すように水平仕切板22cが設けられ、冷却室22の上下 に位置するガスを気密に仕切っている。

ガス冷却循環装置 2 4 は、冷却室 2 2 に隣接して設置され冷却室 2 2 を通過したガスを吸引して加圧する冷却ファン 2 4 a と、冷却ファン 2 4 a に吸引されるガスを間接冷却する熱交換器 2 5 とからなる。冷却ファン 2 4 a は、真空容器 2 1 の循環部 2 1 c に取付けられた冷却ファンモータ 2 4 b により回転駆動され、その中央部からガスを吸引し、外周部から吐出する。熱交換器 2 5 は、例えば内部を水冷された冷却フィンチューブである。この構成により、熱交換器 2 5 で冷却された循環ガスを中央部から吸引し、外周部から吐出した冷却室 2 2 内を上下方向に通過するガスを冷却して循環することができる。

5

10

15

20

25

ガス方向切替え装置26は、この例では、熱交換器25を間隔を隔てて囲む中空のカウリング26aと、カウリング26aを昇降させる昇降シリンダ27とからなる。カウリング26aは、下降位置において冷却室22の下方と連通する下方吸引口26bと、上昇位置において冷却室22の上方と連通する上方吸引口26cとを有する。

この構成により、ガス方向切替え装置26により下方吸引口26bと上方吸引口26cを交互に冷却ファン24aの吸引側に連通させることにより、冷却室22内を上下方向に通過するガスの方向を交互に切り替え、整列化された被処理品の位置による冷却速度の差を低減し、熱処理材全体の歪みを低減するようになっている。

整流器28は、冷却室22の上端及び下端を塞いで上下に設けられ、冷却室2 2を通過するガスの速度分布を均一化させる機能を有する。

上下の整流器28は、互いに積層された均等分配部28aと整流部28bとからなる。なお整流器28は、均等分配部と整流部の両機能を備えてもよい。

均等分配部 2 8 a は、ガス流の圧力損失係数 0.1以上の流路抵抗をつけることにより流速の均等分配化を図るためにガス流 2 に直交する方向(この 例で水平方向)に均等に配置された複数の圧損発生手段を有する。圧損発生手段 は、例えば貫通孔であり、流路抵抗をつけることにより流速の均等分配化を図る ようにな

っている。流路抵抗(圧損)は、ガス流2の全圧損に占める割合が高いほど均等 分配化の効果が高く、好ましくは上下の圧損発生手段の流路抵抗(圧損)を上昇 ガス流2の圧力損失係数0.1以上に設定する。

なお、圧力損失係数ζと損失ヘッド h、流速 V、重力加速度 g との間には、式 (1)の関係がある。

 $h = \zeta \cdot V^2 / (2 \cdot g) \cdot \cdot \cdot (1)$

整流部28bは、例えば格子状に配列した複数の整流グリッドからなり、均等分配部28bを通過したガス流2の流れ方向を整流し、流れ方向を均等化する。

この構成により、複数の圧損発生手段により流速分布を均等化し、複数の整流 グリッドによりガス流の流れ方向を均等化するようになっている。

また、本発明のガス冷却式真空熱処理炉は、冷却室22の上下に冷却室から流出入するガス流の方向を案内する補助分配機構29(例えば吹き込み板)を設け、冷却室の上下面積が大きい場合でも、複数箇所に向かうガス流の方向を最適化し、流れの均一化を高めるようになっている。

15 上記本発明の構成によれば、上下の整流器28により、冷却室22の上端及び下端を塞ぎ通過するガスの速度分布を均一化させるので、冷却領域を通過するガス流の速度変化を最少限度に抑えることができ、被処理品に対して乱れの少ない冷却ガスを吹き付けることができる。また、被処理品1を通った後の出口部も均等に冷却ガスを排出することで、被処理品の中央部にも均等に冷却ガスを通すよりな強制力が発揮され、熱処理材全体の歪みを低減することができる。

上述したように、本発明のガス冷却式真空熱処理炉は、冷却時に熱処理材を高速冷却することができ、熱処理材全体に冷却ガスを均一に供給でき、かつ上向きと下向きの両方において冷却ガスを均一な速度と向きに整流して熱処理材全体の歪みを低減することができる、等の優れた効果を有する。

25

5

10

図6は、本発明の第1実施例による冷却ガス方向切替え装置を備えた真空熱処理炉の全体構成図である。この真空熱処理炉は、真空加熱炉10、ガス冷却炉、及び移動装置30を備えた多室型熱処理炉であり、真空加熱炉10及び移動装置30の構成は、上述した図3の構成と同様である。

図7は図6の部分拡大図である。図6及び図7に示すように、ガス冷却炉20は、真空容器21、冷却室22、ガス冷却循環装置24、冷却ガス方向切替え装置40、整流器28、及び補助分配機構29を備える。真空容器21、冷却室22、整流器22、及び補助分配機構29の構成は、上述した図4及び図5の構成と同様である。

5

20

ガス冷却循環装置24は、冷却室22に隣接して設置され冷却室22を通過したガスを吸引して加圧する冷却ファン24aと、該冷却ファンから吐出されるガスを間接冷却する熱交換器25とからなる。冷却ファン24aは、真空容器21の循環部21cに取付けられた冷却ファンモータ24bにより回転駆動され、その中央部からガスを吸引し、外周部から吐出する。熱交換器25は、例えば内部を水冷された冷却フィンチューブである。この構成により、外周部から吐出した循環ガスを熱交換器25で冷却し、冷却室22内を上下方向に通過するガスを冷却して循環することができる。惠

図8は図7のB部拡大図である。この図に示すように、本発明の冷却ガス方向 15 切替え装置40は、固定仕切板42、回転仕切板44及び回転駆動装置46から なる。

固定仕切板42は、冷却室22とガス冷却循環装置24との間を仕切り、その間を遮断している。回転仕切板44は、固定仕切板42の表面に沿ってこの例では冷却ファン24aと同軸に回転駆動装置46により回転駆動される。回転駆動装置46はこの例では、ラックとピニオンであり、回転仕切板44を1/2回転させて上下を逆にするようになっている。ラックの直動には空圧又は液圧シリング等を用いることができる。また、本発明はこの構成に限定されず、周知の他の駆動装置を用いることもできる。

固定仕切板42の中央部には軸受43aを内蔵する軸受箱43が設けらる。こ 25 の軸受箱43は、支持フレーム43bにより、真空容器21の循環部21cから 支持されている。

回転仕切板44は、その中心部において回転軸45に固定され、中心部に嵌装されたキーによって回転軸45に対する相対的な回転が拘束されている。この回転軸45は軸受43aにより冷却ファン24aと同軸に支持されている。圧縮バ

ネ47が、回転軸45の軸端部(図で左端と支持板45a)と回転仕切板44の間に圧縮状態で挟持され、回転仕切板44を常に回転仕切板44に向けて付勢し、その間の隙間を低減するようになっている。このため、付加すれば機能が向上する。

5 前述の水平仕切板22c(図5参照)の端面と固定仕切板42の端面に、シール材48が張付けられており、回転仕切板44の間、及び回転仕切板44との間の隙間をシールするようになっている。このシール材48は、例えば摩擦の少ない鉛黄銅、グラファイト、等であり、リークを低減しかつ動きを滑らかにしている。

10 図9A及び図9Bは図7のC-C線における断面図である。図9AはC-C線における断面図、すなわち回転仕切板44の正面図であり、図9Bは回転仕切板44を除去した断面図、すなわち固定仕切板42の正面図である。

15

固定仕切板42は、ほぼ全面を貫通する開口42aを有する。すなわち、この例では、支持フレーム43bと同位置で半径方向に延びる細長い放射部42bと、最外周、中央部、及び中間部の細いリング状の円形部42cとからなる。なお、この図で中央の円形部42cには、上述した軸受箱43が取付られている。なお、開口42aの位置はこの例に限定されず、可能な範囲で広く設定するのがよい。回転仕切板44は、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸

20 図9A及び図9Bの第1実施例において、冷却室22は、その内側を上下方向 に通過するガス流路を有し、冷却室内22をガスが下方に流れるときに、吸引開 口44aが冷却室の下方のみと連通しかつ吐出開口44bが冷却室の上方のみと 連通し、冷却室44内をガスが上方に流れるときに、吸引開口44aが冷却室の 上方のみと連通しかつ吐出開口44bが冷却室の下方のみと連通するように開口 25 位置が設定されている。

引開口44aと吐出開口44bを有する。

なお、この例において、吸引開口 44a はほぼ 1/2 の円形、吐出開口 44b はほぼ 1/2 の扇形であり、互いに水平軸(前述の水平仕切板 22c)に対して反対側に設けられている。

この構成により、冷却室22とガス冷却循環装置24との間を仕切る炉体内面

積Aのうち、1/2づつをガス冷却循環装置の吸込口と吐出口とし、更に吸込口と吐出口のうち、1/2づつを下方、上方とすることで、吸引開口44aと吐出開口44bを炉体内面積Aの約1/4づつに設定することができる。従って、風路面積を大きくとれ、ガスの通過流速を低減でき、圧損を小さくできる。

5 また、固定仕切板 4 2 とガス冷却循環装置 2 4 の間は、内側全面がガス冷却循環装置の吸込口に連通し、外側全面がガス冷却循環装置の吐出口に連通しているので、吐出口/吸込み口の隙間を十分取ることで半面しか開口していなくても反対面への回り込みが可能となり、熱交換器全体を有効利用できる。

上述した本発明の構成によれば、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固 10 定仕切板の表面に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過する ガスの方向を交互に切り替えるので、流れ方向に対して回転仕切板が垂直に動く 回転駆動であるため、高圧ガス(密度が高いガス体)であっても風圧の影響を受 けにくくスムースに風路を切替えることができる。

また、回転仕切板が、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する 15 吸引開口と吐出開口を有するので、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積 差が生じにくく、安定したガス冷却が可能である。また、構造が簡潔であり単一 の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる。

20

なお、これまでは上下流のガス流れについて実施形態を示したが、回転仕切板を90°回転させて冷却室の整流器を側面(左右)に付けることで、左右流の切替え機構とすることもできる。

また、熱交換器 2 5 は冷却ファン 2 4 a の出口と固定仕切板 4 2 との間の流路に設置された実施形態を示したが、これに代えて、回転仕切板 4 4 の外側(冷却室 2 2 側)に設置されていてもよい。

25 図10A及び図10Bは、本発明の第2実施例による冷却ガス方向切替え装置を示すものであり、図9A及び図9Bと同様の断面図である。図10AはC-C線における断面図、すなわち回転仕切板44の正面図であり、図10Bは回転仕切板44を除去した断面図、すなわち固定仕切板42の正面図である。

この第2実施例は、冷却室内でガスを上下方向に流すとき(上下流)と、冷却

室内でガスを水平方向に流すとき(水平流)の両方に対応できるようになっている。

すなわち、この例において、吸引開口44aはほぼ1/4の円形、吐出開口44bはほぼ1/4の扇形であり、互いに水平軸(前述の水平仕切板22c)に対して反対側に設けられている。

5

10

15

20

この第2実施例では、冷却室22内をガスが上下方向に流れるときには、図9A及び図9Bと同様に、吸引開口44aが冷却室22の下方のみ又は上方のみと選択的に連通し、かつ吐出開口44bが冷却室の上方のみ又は下方のみと選択的に連通するようになっている。また、図10Aに示すように、冷却室22内をガスが水平方向に流れるときには、吸引開口44aが冷却室のいずれかの片側のみに選択的に連通し、かつ吐出開口44bが冷却室の反対の片側のみと選択的に連通するように開口位置が設定されている。

この構成により、冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板の表面 に沿って回転仕切板を回転駆動するだけで、冷却室内を通過するガスの方向を上 下方向及び左右方向に自由に切り替えることができる。

なお、本発明の冷却ガス方向切替え装置は、加熱室と冷却室が分離した装置に 限らず、加熱と冷却を1室で行える単室炉でも使用は可能である。

上述したように、本発明の真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置は、風圧の影響を受けにくくスムースに冷却ガスの流れ方向(風路)を切替えることができ、開口面積の変動や吸込口と吐出口の開口面積差が生じにくく、安定したガス冷却が可能であり、構造が簡潔であり単一の駆動装置で切替えが可能であり、大きな開口面積を確保できる、等の優れた効果を有する。

なお、本発明のガス冷却式真空熱処理炉およびその冷却ガス方向切替え装置を いくつかの好ましい実施例により説明したが、本発明に包含される権利範囲は、 これらの実施例に限定されないことが理解されよう。 反対に、本発明の権利範囲 は、添付の請求の範囲に含まれるすべての改良、修正及び均等物を含むものである。

請求の範囲

- 1. 加熱した被処理品を加圧した循環ガスで冷却するガス冷却炉を備えたガス冷却式真空熱処理炉であって、
- 5 前記ガス冷却炉は、被処理品を静置する冷却領域を囲みその内側に上下方向に 断面一定のガス流路を形成する冷却室と、該冷却室内を上下方向に通過するガス を冷却して循環させるガス冷却循環装置と、冷却室内を上下方向に通過するガス の方向を交互に切り替えるガス方向切替え装置と、冷却室の上端及び下端を塞ぎ 通過するガスの速度分布を均一化させる上下の整流器と、を備えたことを特徴と するガス冷却式真空熱処理炉。
 - 2. 前記上下の整流器は、互いに積層された均等分配部と整流部とからなり、或いは均等分配部と整流部の両機能を備え、

均等分配部は、上昇ガス流の圧力損失係数 0. 1以上の流路抵抗をつけることにより流速の均等分配化を図るために前記上昇ガス流に直交する方向に均等に配置された複数の圧損発生手段を有し、

15

20

整流部は、均等分配部を通過した上昇ガス流の流れ方向を整流する複数の整流グリッドからなる、ことを特徴とする請求項1に記載のガス冷却式真空熱処理炉。

- 3. 更に、冷却室の上下にガス方向切替え装置から流出入するガス流の方向 を案内する補助分配機構を設ける、ことを特徴とする請求項1に記載のガス冷却 式真空熱処理炉。
- 4. 前記ガス冷却循環装置は、冷却室に隣接して設置され冷却室を通過した ガスを吸引して加圧する冷却ファンと、該冷却ファンに吸引されるガスを間接冷 却する熱交換器とからなり、

前記ガス方向切替え装置は、前記熱交換器を間隔を隔てて囲む中空のカウリン 25 グと、該カウリングを昇降させる昇降シリンダとを備え、前記カウリングは、下 降位置において冷却室の下方と連通する下方吸引口と、上昇位置において冷却室 の上方と連通する上方吸引口とを有する、ことを特徴とする請求項1に記載のガ ス冷却式真空熱処理炉。

5. 被処理品を静置する冷却領域を囲む冷却室と、該冷却室内を通過するガ

スを冷却して循環させるガス冷却循環装置とを備え、加熱した被処理品を加圧した循環ガスで冷却するガス冷却式真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置であって、

冷却室とガス冷却循環装置との間を仕切る固定仕切板と、該固定仕切板の表面 に沿って回転駆動される回転仕切板とを有し、

固定仕切板はほぼ全面を貫通する開口を有し、回転仕切板は、ガス冷却循環装置の吸込口と吐出口に部分的に連通する吸引開口と吐出開口を有し、これにより冷却室内を通過するガスの方向を交互に切り替える、ことを特徴とするガス冷却式真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置。

6. 前記冷却室は、その内側を上下方向に通過するガス流路を有し、

5

.0

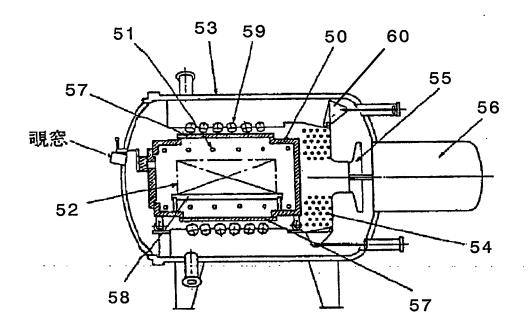
.5

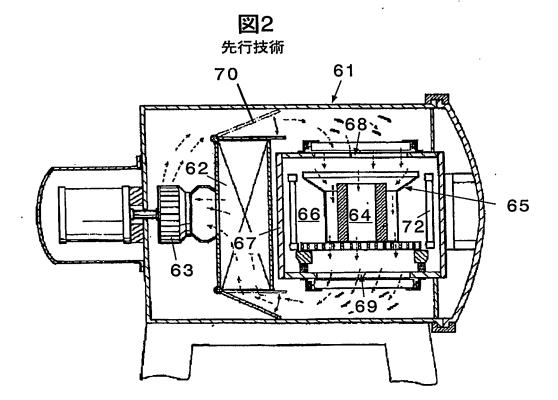
冷却室内をガスが下方に流れるときに、吸引開口が冷却室の下方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の上方のみと連通し、

冷却室内をガスが上方に流れるときに、吸引開口が冷却室の上方のみと連通しかつ吐出開口が冷却室の下方のみと連通するように開口位置が設定されている、ことを特徴とする請求項5に記載のガス冷却式真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置。

- 7. 前記冷却室内をガスが上下方向に流れるときに、吸引開口が冷却室の下方のみ又は上方のみと選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の上方のみ又は下方のみと選択的に連通し、
- 10 前記冷却室内をガスが水平方向に流れるときに、吸引開口が冷却室のいずれかの片側のみに選択的に連通しかつ吐出開口が冷却室の反対の片側のみと選択的に連通するように開口位置が設定されている、ことを特徴とする請求項5に記載のガス冷却式真空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置。
- 8. 前記ガス冷却循環装置は、冷却室に隣接して設置され冷却室を通過した ガスを吸引して加圧する冷却ファンと、該冷却ファンから吐出されるガスを間接 冷却する熱交換器とからなる、ことを特徴とする請求項5に記載のガス冷却式真 空熱処理炉の冷却ガス方向切替え装置。

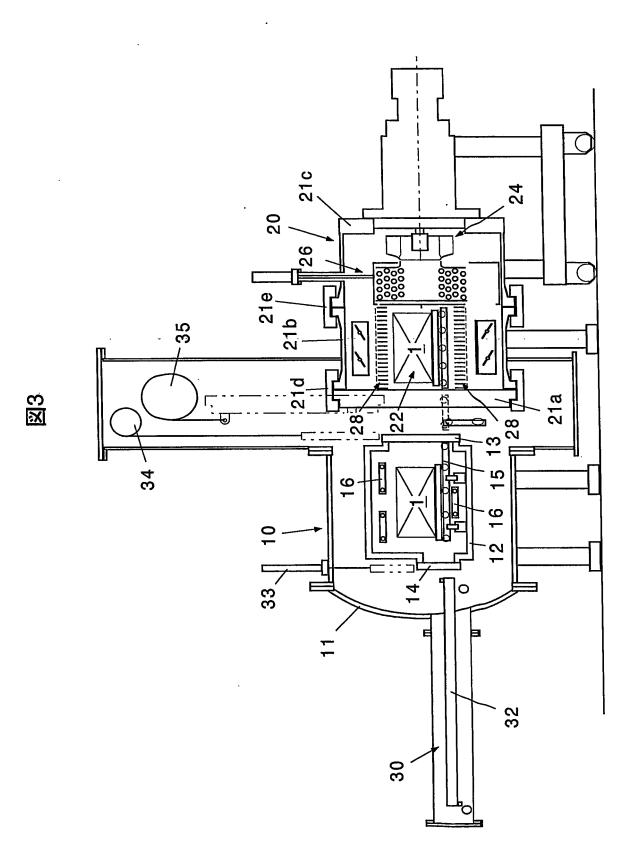
図1 先行技術

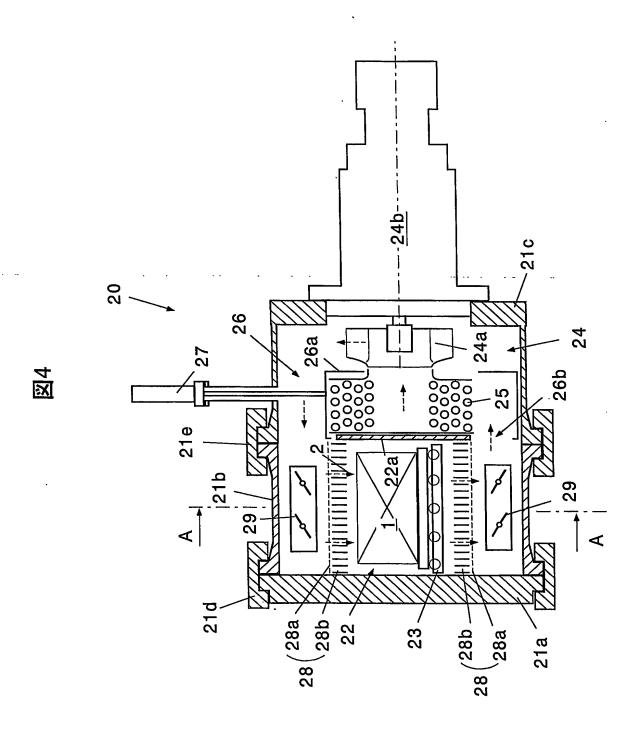




WO 2005/001360 PCT/JP2004/004643

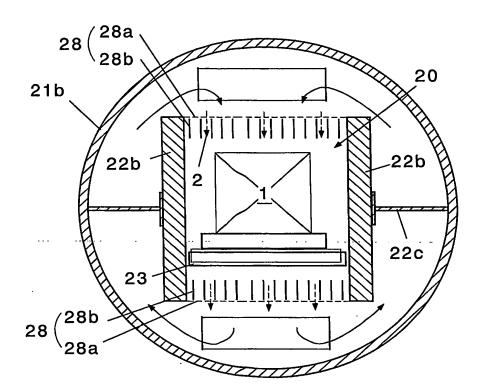
2/9

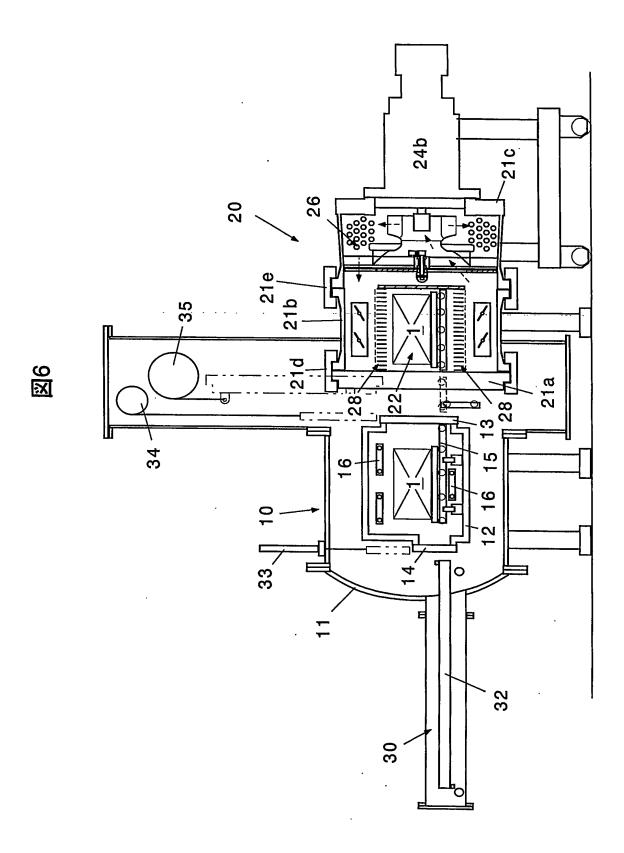




4/9

図5





6/9

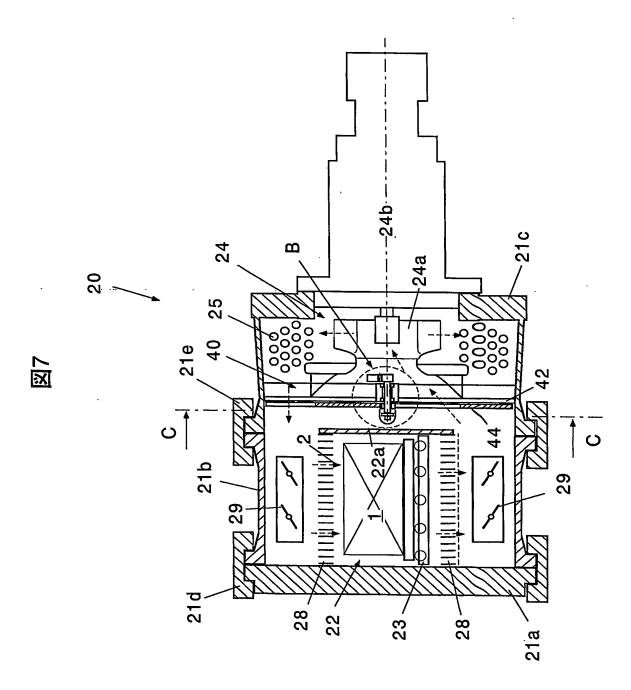
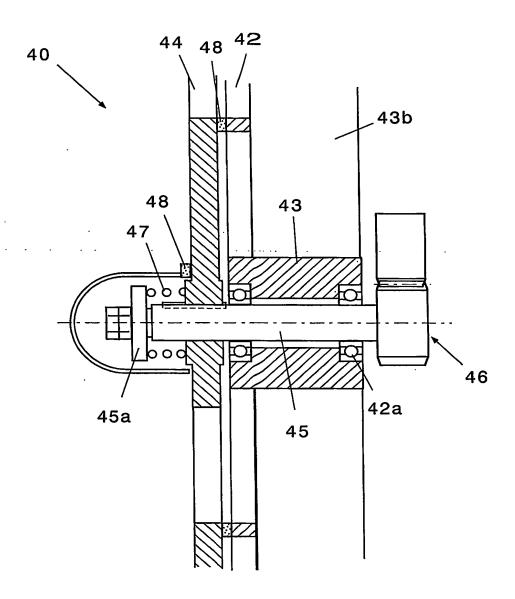
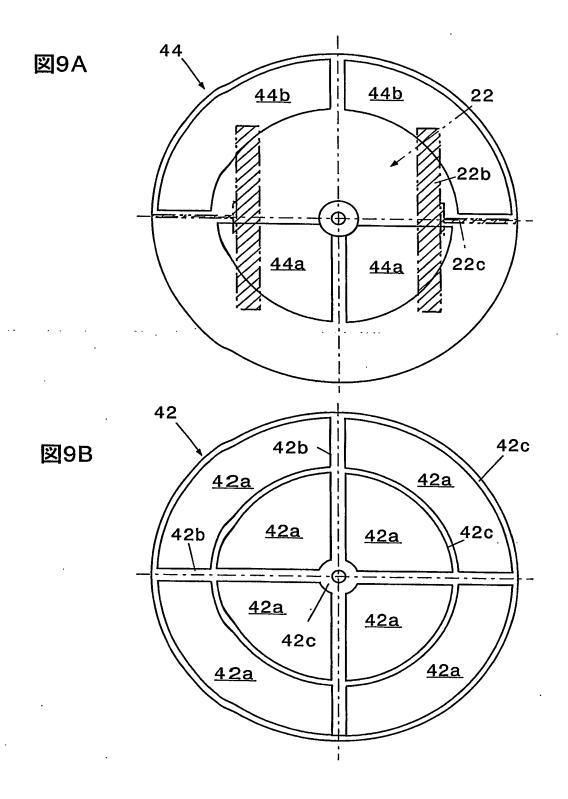
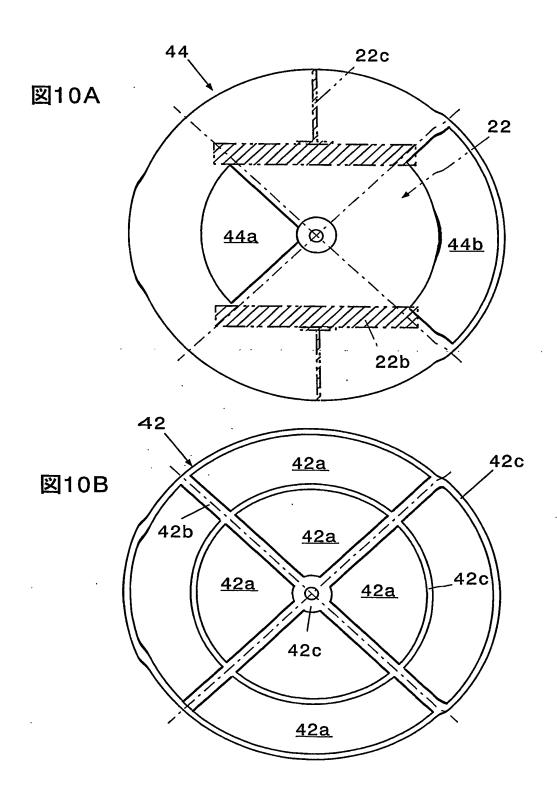


図8







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004643

	OT ACCOUNT	AMIONI OF STATE OF A LINE	ECT/UP.	2004/004643					
A.	CLASSIFIC Int.Cl ⁷	ATION OF SUBJECT MATTER F27D9/00, F27B5/16							
		ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC						
	FIELDS SEA								
Min	imum docum	rentation searched (classification system followed by class F27D9/00, F27B5/00-5/18	ssification symbols)						
		· ·							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched									
	Jitsuyo Shinan Koho 1922—1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2004								
ים.	Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004								
rle	cuonic data b	ase consulted during the international search (name of da	ata base and, where practicable, search t	erms used)					
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT									
	Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
	Y	JP 11-153386 A (Ishikawajima-	-Harima Heavy	1-3					
	Α	Industries Co., Ltd.), 08 June, 1999 (08.06.99),		4-8					
		Claims							
		(Family: none)							
	Y	JP 5-230528 A (Daido Steel Co	o., Ltd.),	1-3					
	A	07 September, 1993 (07.09.93)	,	4-8					
		Claims; Par. Nos. [0008], [0006] (Family: none)	ısı; rig. l						
	v.	-							
	Y A	JP 5-001887 A (Daido Steel Co 08 January, 1993 (08.01.93),	o., Ltd.),	1-3					
		Claims; Par. No. [0010]; Fig.	1	4-8					
	İ	(Family: none)							
			•						
	l								
×] Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.						
* " * "	Special cates	gories of cited documents:	"T" later document published after the in	ternational filing date or priority					
"A"	to be of part	efining the general state of the art which is not considered icular relevance	date and not in conflict with the appli the principle or theory underlying the	cation but cited to understand					
"E"	•	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be cons	claimed invention cannot be					
"L"	document w	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alon	ie .					
"o"	special reaso	on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive	e step when the document is					
"P"	document pu	referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ublished prior to the international filing date but later than	combined with one or more other suc being obvious to a person skilled in the	h documents, such combination he art					
	the priority o	gate claimed	"&" document member of the same patent	•					
Dat	te of the actua	d completion of the international search	Date of mailing of the international sea						
	Ul July	y, 2004 (01.07.04)	20 July, 2004 (20.						
Name and mailing address of the ISA/			Authorized officer						
Japanese Patent Office									
	Facsimile No. Telephone No.								
rom	n PCT/ISA/21	0 (second sheet) (January 2004)							

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/004643

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	Relevant to claim No.	
Y ·A	JP 61-015079 A (Ishikawajima-Harima Heav Industries Co., Ltd.), 23 January, 1986 (23.01.86), Claims (Family: none)	У	1-3 4-8
		·	
		·	
			·

国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP2004/004643 Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' F27D9/00, F27B5/16 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁷ F27D9/00,F27B5/00-5/18 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 Y JP 11-153386 A (石川島播磨重工業株式会社) 1999. 0 $1 \sim 3$ Α 6.08, 特許請求の範囲 (ファミリーなし) 4~8 Y JP 5-230528 A (大同特殊鋼株式会社) 1993.09.0 $1 \sim 3$ 7, 特許請求の範囲、0008段落、0013段落、図1 (ファミリーな Α $4 \sim 8$ し) Y JP 5-001887 A (大同特殊鋼株式会社) 1993.01.0 $1\sim3$ Α 8,特許請求の範囲、0010段落、図1(ファミリーなし) $4 \sim 8$ Y JP 61-015079 A (石川島播磨重工業株式会社) 1986. 0 $1\sim3$ Α 1. 23, 特許請求の範囲 (ファミリーなし) $4 \sim 8$ C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発 明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1 以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 20, 7, 2004 01.07.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 K 8924 日本国特許庁(ISA/JP)

米田 健志

電話番号 03-3581-1101 内線 3435

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (2004年1月)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号